

# Remover300 剥离液

产品名称	Remover300 剥离液
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

## 产品详情

Remover 300去胶液可以应用于传统半

导体、化合物半导体、芯片封装制造制程中

的光刻胶、灰化/刻蚀残渣去除。该产品具

有去胶速度快、使用寿命长、对金属腐蚀

弱等优点，主要应用于半导体前道、无线设

备、光电子器件、MEMS 和封装等领域。产品性能特点

高速去胶能力，尤其适合自动清洗线；

对铝、化合物半导体材料腐蚀弱；

去胶后可直接纯水冲洗；

长使用周期（正常条件下 24 hours）；

不含氟化物及羟胺；

应用领域

光刻胶去胶及蚀刻残渣去除；

各类硅基、化合物半导体；

各类激光器生产 (VESEL) ;

芯片封装 ;

适配储存材料

304/316L 不锈钢;

玻璃、石英;

PTFE、PFA、Teflon、Kalrez.etc

PP、PE;

产品技术信息 PRODUCT RANGE

推荐工艺 Recommended process

金属腐蚀速率 ( A/Min@85 ) 基底腐蚀速率 ( A/Min@85 )

Al Ti W GaAs SiO<sub>2</sub> TEOS

< 0.5 < 0.5 0.4 < 1 < 0.8 < 0.9

Bath Lift > 24 小时 粘度@25 2.9 cSt 冰点 -30

闪点 (开杯) 103 溶解度 (水) 沸点 165

闪点 (闭杯) 93 表面张力 41 dyne/cm 密度 1.07 g/ml

R

e

m

o

v